

略 歴

黒部 篤（くろべ あつし）氏

昭和32年生まれ 64歳

元株式会社東芝研究開発センター首席技監（常務待遇）

理学博士（東京大学）

専門分野：半導体デバイス・材料全般

現在は株式会社東芝を退職し、東京大学産学協創アドバイザーや、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）のCREST研究総括、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の技術委員を務める

【略歴】

昭和54年 東京大学 理学部 物理学科 卒業

昭和59年 東京大学大学院 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修了 理学博士

昭和59年 株式会社東芝 総合研究所 入社

平成 3年 英国 Toshiba Cambridge Research Centre 研究員

英国 Cambridge 大学 Cavendish 研究所 客員研究員

平成12年 株式会社東芝 研究開発センター LSI 基盤技術ラボラトリー室長

平成22年 株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社

半導体研究開発センター センター長

平成25年 株式会社東芝 研究開発センター 理事

平成26年 国立研究開発法人科学技術振興機構

戦略的創造研究推進事業（CREST）

「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」
研究総括

平成28年 株式会社東芝 研究開発センター 首席技監（常務待遇）

令和 2年 株式会社東芝 退職

令和 2年 株式会社東芝 特別嘱託（令和3年まで）

令和 2年 東京大学 総長室アドバイザー（令和3年まで）

令和 3年 東京大学 産学協創アドバイザー

令和 3年 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術委員